

MANUFACTURE OF SOLID-STATE IMAGE SENSING DEVICE

Patent Number:

JP3152973

Publication date:

1991-06-28

Inventor(s):

NAKAI JUNICHI; others: 01

Applicant(s):

SHARP CORP

Requested Patent:

☐ J<u>P3152973</u>

Application Number: JP19890291709 19891109

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L27/14

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To obtain a solid-state image sensing device of high reliability by a method wherein a circular arc-shaped micro-lens formed of a far ultraviolet ray negative type resist layer by heating is subjected to a light exposure treatment with ultraviolet or far ultraviolet rays.

CONSTITUTION: A far ultraviolet negative type resist layer is heated for the formation of a circular arc shaped micro-lens 28. Furthermore, the lens 28 is subjected to a light exposure treatment through ultraviolet or far ultraviolet rays to be cured. As mentioned above, a micro-lens is formed through a thermal treatment and then cured by the irradiation with ultraviolet or far ultraviolet rays, so that the micro-lens concerned becomes high in thermal stability.

Data supplied from the esp@cenet database - 12



19 日 本 国 特 許 庁 (JP)

⑪特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-152973

®Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成3年(1991)6月28日

H 01 L 27/14

8122-5F H 01 L 27/14

D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

図発明の名称 固体撮像素子の製法

②特 願 平1-291709

20出 願 平1(1989)11月9日

⑩発 明 者 仲 井 淳 一 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

⑩発 明 者 仲 俊 一 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

⑪出 願 人 シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

明 和 書

1.発明の名称

固体撮像素子の製法

2. 特許請求の範囲

(1) 画素ごとにマイクロレンズを形成して、外 光を受光部に集光させるようにした固体撮像素子 の製法において、

上記マイクロレンズとして、紫外線あるいは遼 紫外線用のネガ型レジスト層が使用され、

各受光部に対向して形成された上記レジスト層 を加熱処理してマイクロレンズを形成し、

その後、紫外線あるいは遠紫外線電光してマイ クロレンズを形成するようにしたことを特徴とす る固体嫌像素子の製法。

3. 発明の詳細な説明

{産業上の利用分野]

この発明は、CCDなどの固体機像素子の製法に関する。

[従来の技術」

CCDなどの固体操像素子では、チップサイズの小型化及び多面素化に伴い、これに形成される 画素としての受光部の面積も縮小化されるように なってきた。そのため、各受光部での受光量が減 少し、感度が低下する問題が派生した。

これを解決するため、画素となる各受光部の上面に、直接オンチップ法によりカラーフィルタを形成し、さらにその上に透明樹脂層を形成して、この表面の凹凸形状で入射光量を受光部に集光させることによって、受光部における実効的な受光面積を増やして、感度の低下を補うようにした固体撮像素子が提案されている。

あるいはまた、ボジレジストでマイクロレンズ 形状を形成し、それをマスクにドライエッチング 技術で下地材料に転写する方法がある。このマイ クロレンズで入射光量を集光させることによって、 受光部における実効的な受光面積を増やして、上 述と同じく感度の低下を補うようにした固体優像 素子が提案されている。

[発明が解決しようとする課題]

ところが、前者の方法では、既存の材料や装置などで、比較的簡単に凹凸状の樹脂層を形成できる反面、画素ごとに均一に形成することが困難である。

後者の方法は、マイクロレンズ形状をエッチングによって下地材料に転写するため、このエッチングのばらつきによってマイクロレンズの形状が変わり、これまた均一なマイクロレンズを形成できない問題がある。

また、上述したような例脂層によって凹凸形状やマイクロレンズを形成した場合には、熱的に変形しるい状況下にある。

さらに、固体・・なって、一用に形成するには、カラーフィルタを配置する必要があるが、このカラーフィルタを上述したマイクロレンズと共に、オンチップ上に形成した場合、マイクロレンスを形成する際の加熱処理工程がカラーフィルタに悪影響を及ぼさないようにしなければならない。カラーフィルタは耐熱性が余り良くないからであ

3

熱処理してマイクロレンズを形成し、

その後、紫外線あるいは遠紫外線霧光して、熱 的に安定で、均一なマイクロレンズを形成するよ うにしたことを特徴とするものである。

レジスト層の下地層として、レジスト層と同様 の紫外線あるいは遠紫外線用のネガ型レジスト、 若しくは熱硬化型樹脂を使用することができる。

(作 ·用)

集光手段としては、マイクロレンズが使用される。このマイクロレンズ28としては紫外線あるいは遠紫外線用のネガ型感光性倒脂がレジスト層52として使用され、各受光郎14に対向して形成されたこのレジスト層52が加熱処理される。

このレジスト層 5 2 が加熱されると、レジスト層 5 2 が熱変形を受けて円弧形状に変化して、球形若しくはカマボコ形のマイクロレンズ 2 8 に変形する。

その後、紫外線あるいは選紫外線によって霧光 処理して、このマイクロレンズ28を硬化させる。

レジスト暦52はエッチング処理によって均一

z.,

これに対して、マイクロレンズの市場での信頼性を高めるには、マイクロレンズを形成する際の加熱処理がなるべく高温で実施できるように、軟化点の高い材料をマイクロレンズ川レジスト層として使用する必要がある。この両者の問題を同時には、まだ解決されていない。

そこで、この発明ではこのような従来の課題を構成簡単に解決したものであって、マイクロレンズ用のレジスト層として紫外線あるいは遠紫外線用のネガ型感光性併脂を使用することによって、 然的に安定で、しかも均一なマイクロレンズを形成できるようにしたものである。

[課題を解決するための手段]

上述した課題を解決するため、画素ごとにマイクロレンズを形成して、外光を受光部に集光させるようにした固体操像素子の製法において、

マイクロレンズとして、紫外線あるいは選紫外 線用のネガ型レジスト層が使用され、

各受光部に対向して形成されたレジスト層を加

4

な形状となる。また、このマイクロレンズ28は加熱処理によって形成された後、紫外線あるいは 遠紫外線照射により硬化させているので、外から 加えられる然に対しても安定なものとなる。

〔実施例〕

統いて、この発明に係る固体機像案子の製法の一例を第1回以下を参照して詳細に説明する。固体撮像素子としてはCCDを例示する。

第1図はカラー固体操像素子の一例である。

このカラー固体操像素子60において、半導体 基板12はP形、受光部14はN形である。受光 部14、14間に挟まれた転送部16の半導体基 板12上には、図のように2層の転送電板18、 20がSi02などの絶縁層22を介して形成されている。

そして、この転送電極20の上面には遮光メタル24が被着形成され、転送部16に外光が入射 しないようになされている。

遮光メタル24の上面及び受光部14の上面は 赤々アクリル樹脂などを使用した平均化魔26が

5

強布されて、その表面が平坦化される。そして、カラー化するにために、この平坦化暦26の上面に、図のようなカラーフィルタ40R、40Bが形成されている。カラーフィルタ40R、40G、40Bは失々受光部14に対峙するように形成され、夫々の受光部14にはR、G、B(赤、緑、青)の単色光が入射する。

カラーフィルタ40R、40G、40Bはゼラチン、カゼインなどを染料で染めて形成することができる。

さらに、上記カラーフィルタ40R、40G、 40Bを保護し、且つレンズ層を固定するために、 保護層30を形成する。この保護層30の上面に、 受光部14と対向する位置にマイクロレンズ28 が形成される。

上記保護層 300 は、上記マイクロ レンズ 28 を 形成する前に、硬化処理を施しておく。すなわち、 紫外線あるいは遠紫外線用レジストを使用する場合は、紫外線あるいは速紫外線を照射し、また熱 硬化型樹脂を使用する場合は、加熱、硬化処理を

7

ル24、平坦化層26などが、周知の手法で形成 される。

平坦化層26は、アクリル樹脂の他に、ボリイミド樹脂、イソシアネート樹脂、ウレタン樹脂などでもよい。本例では、アクリル樹脂「FVRー10」(富士薬品(株)製)を使用している。この平坦化層26は、その厚みが5.0μmとなる。ようにスピンコート法などによって塗布されるのように、カラーフィルタ40R.40G.40日を形成した後、保護層30を塗布し、硬化と見を施す。これらの層をまとめて固定層50の上面に、紫外球あるいは速紫外線用のレジスト層52がスピンコート法などによって、厚さが2.0μm程度となるように塗布される(同図 Λ)。

ネガ型レジスト層52としては、「MES-u」 (日本合成ゴム(株)製)などの感光性樹脂を使用できる。

ネガ型 レジスト暦 52を途布後、これを乾燥さ

施しておく。この処理によって、上記マイクロレンズ28を形成する場合、上記保護層30は熱変形しないため、良好な形状のマイクロレンズを形成することができる。

上記マイクロレンズ28は、透明な紫外線あるいは遠紫外線用のネガ型感光性倒脂が使用される。この感光性倒脂をレジスト層 5 2 (後述する) として使用する。このレジスト層は、紫外線あるいは遠紫外線を照射する前は、加熱処理によって熱変形を受けるので、当初の形状が層状でも、これが球状ないしはカマボコ状に変形する。但し、最終的にマイクロレンズ28を形成する工程では、紫外線あるいは遠紫外線を照射して硬化処理が行なわれる。

続いて、この発明に係る固体操像素子の製法の 一例を第2図以下に示す。

まず、シリコンなどのP型半導体基板12の所定位置からN型不純物をドーブして受光部14が 形成される。そして、半導体基板12の上面には第1間で示した、転送電極18.20、逸光メタ

8

せたのち、その上面に感光性樹脂「A Z 4 3 5 0」 (ヘキストジャパン(株)製)などの紫外株用ポジレジスト層 5 4 が、3.0 μ m 程度の厚みとなるように塗布される(同図 B)。そして、これが所定のパターンとなるように受光部 1 4 以外が紫外株で露光、現像されてパターニングされる(同図 C)。

次に、このパターン化されたポジレジスト層 5 4 をマスクとして違紫外線用ネガ型レジスト層 5 2 が、酸素ガス O 2 とフッ化炭素ガス C F 4 の混合ガスによってドライエッチングされて、遠紫外線用ネガ型レジスト層 5 2 がパターニングされる(同図 D)。

その後、ボジレジスト暦 5 4 を 剝離してから (同図E)、160 で以下の温度、好ましくは 1 30~150 での温度条件下で加熱処理が行なわれて連紫外線用ネガ型レジスト暦 5 2 が熱変形される (同図F)。これによって、図では連紫外線用ネガ型レジスト暦 5 2 が球状となって、マイクロレンズ28となる。 加熱温度を160℃以下にしたのは、固定層50中に介揮されたカラーフィルタ40R、40G、40Bの耐熱性を考慮したもので、このカラーフィルタ40R、40G、40Bが熱変質しないようにするためである。

速紫外線用ネガ型レジスト層 5 2 を熱変形させてマイクロレンズ 2 8 を形成した後は、200~300 nmの速紫外線を照射して霧光処理を施すことにより、マイクロレンズ 2 8 の構成樹脂層を硬化させる。

ネガ型レジスト層 5 2 を熱変形後、これを硬化させると、マイクロレンズ 2 8 は熱的に安定する。

このように、遠紫外線用ネガ型レジスト層 5 2 を熱変形後、硬化処理したのは、遠紫外線で霧光する前は、ネガ型レジスト層 5 2 は 1 2 0 ~ 1 6 0 ℃で容易に軟化するが、一旦遠紫外線で露光すると、その後は熱的に非常に安定する性質を利用したものである。

なお、本発明における関係機像業子の製法はカ ラー用に限らず、白黒用にも適用され、またCC

1 1

16 · · · 転送部

26・・・平坦化層

28 . . . マイクロレンズ

4 0 R ~ 4 0 B

・・・カラーフィルタ

50・・・固定層

5 2・・・ 連紫外線用レジスト層

54・・・ポジレジスト層 ...

60・・・カラー固体優像素子

特許出願人 シャープ 株 式 会 社 代 理 人 弁理士 山口 邦夫 Dに限らず、他の方式の操像素子にも利用できる。 [発明の効果]

以上説明したように、この発明はレジスト層として感光性樹脂を使用すると共に、加熱および硬化条件を所望のごとく選定して固体操像素子を製造するようにしたものである。

これによれば、比較的低温の加熱条件によって チップサイズにあったマイクロレンズを形成できると共に、最終工程で、紫外線あるいは遠紫外線 を露光して硬化させるため、作られたマイクロレ ンズは熱的に非常に安定したものとなっている。

従って、この発明は信頼性の高い固体操像素子の製法を提供できる。

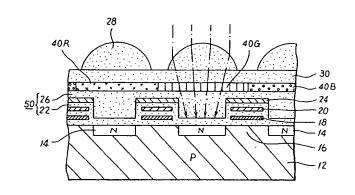
4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明に係る固体摄像素子の断面図、 第2図はその製法の一例を示す工程図である。

12・・・半導体基板

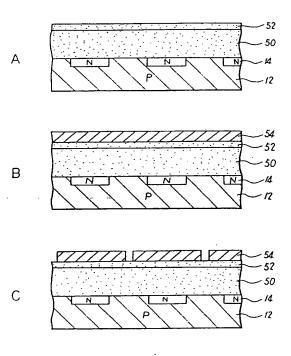
14・・・受光部

12



<u>60</u>:カラー固体撮像素子

第 1 図



第 2 図

